# MEASURING JIG FOR DC CHARACTERISTIC OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent number:

JP3175367

**Publication date:** 

1991-07-30

Inventor:

OKADA MANABU

Applicant:

SHARP KK

Classification:

- international:

G01R1/073; G01R31/26; H01L21/66; G01R1/073;

G01R31/26; H01L21/66; (IPC1-7): G01R1/073;

G01R31/26; H01L21/66

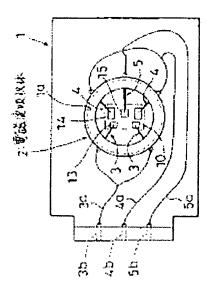
- european:

Application number: JP19890315548 19891204 Priority number(s): JP19890315548 19891204

Report a data error here

### Abstract of JP3175367

PURPOSE:To always accurately measure DC by providing an electromagnetic wave absorbing body in the vicinity of the probe on a substrate. CONSTITUTION:By providing an electromagnetic wave absorbing body 2 in the vicinity of the probe groups 3 - 5 on a substrate 1, almost all of the high frequency noise generated from a semiconductor device 10 is absorbed by the absorbing body 2. By this constitution, the AC signal flowing to the device 10 through the probe groups 3 - 5 is extremely reduced and the oscillation phenomenon of the device is suppressed and, therefore, DC can be always accurately measured.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**BEST AVAILABLE COPY** 

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-175367

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)7月30日

.G 01 R 1/073

6723-2G 8203-2G

31/26 21/66 H 01 L

E J B 7013-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称 半導体装置の直流特性測定用治具

> 頭 平1-315548 の特

平 1 (1989)12月 4 日 忽出

岡 ⑫発 明 者  $\blacksquare$  大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

勿出 顯 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

個代 理 人 弁理士 西田

> 明 細

1. 発明の名称

半導体装置の直流特性測定用治具

2. 特許請求の範囲

基板に、被測定半導体装置の各信号取り出し電 極の配設パターンに対応して複数のプローブ針が 配設され、かつ、その各プローブ針に個別に導通 する配線が配設されてなる測定治具において、上 記基板上の、上記プローブ針群の近傍に電磁波吸 収体が配設されていることを特徴とする、半導体 装置の直流特性測定用治具。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、半導体装置の測定用治具に関し、特 に、高周波半導体デバイスの製造工程においてウ ェハ状態での直流特性測定に適した測定治具に関 する.

<従来の技術>

半導体装置の測定治具としては、例えば第4図 に示すように、基板 4 1 に設けられた開口部 4 1 a の周辺に、対象となる半導体装置50の各信号取 り出し電極にそれぞれ対応した多数のプローブ針 43、44、45を配列した、いわゆるプロープ カードがある。

このようなプローブカードを用いて、例えば化 合物半導体による高周波FETデバイスの直流特 性を測定する場合、不定な周波数における発振現 象が起こり易い。この発振現象は、FETデバイ スから発生する高周波雑音がプローブ針の配線等 によって捕らえられ、これにより配線路内に交流 信号が流れ、この交流信号がデバイスへと導かれ 増幅されることによって起きる。このような発振 現象が起きると、直波測定を正確に測定できなく なることがある。

そこで、従来、各プローブ針に接続する配線を 基板内部配線とはせず、電磁吸収体であるフェラ イトピーズを付けた外部配線43a.44aおよ び45aにより接続することによって、高周波雑 音に対するシールドを行い、発振現象の原因とな る交流信号が配線路内に流れることを防止してい

## <発明が解決しようとする課題>

上記の問題点を解決するために、本発明では、 実施例に対応する第1図、第2図に示すように、 基板1上の、プローブ針群3,4、5の近傍に、 電磁波吸収体(例えばフェライト等)2を設けて いる。

ハWをステージ20上に載置し、位置合わせすることによって、各プローブ針3, 4, 5の先端をそれぞれ対応する電極13, 14, 15に接触させることができる。

各プローブ針3、4、5は、配線3a、4a、5aによりコネクタ3b、4b、5bにそれぞれ接続されている。この配線3a、4a、5aは、従来と同様に、フェライトピーズ付き配線を用いる。

さて、本発明実施例においては、基板1上面に各プロープ針3、4、5根本部の内方周縁に沿うフェライト製リング2を配設している。ここで、フェライトは強磁性体で、電磁波を非常によく吸収することが知られており、従って、フェライト製のリング2を設けることにより、HEMTデバイス10から発生する高周波雑音の殆どはこのフェライト製リング2によって吸収される。

以上の構成により、被測定HEMTデバイス10 から各コネクタ3b、4b、5bまでのそれぞれ の電流通路に、高周波錐音による交流信号が流れ

#### <作用>

プローブ針群3. 4および5の近傍に電磁波吸収体2を設けることにより、半導体装置10から発生する高周波雑音の殆どは、電磁吸収体2によって吸収される。これにより、プローブ針3. 4 および5を通じて半導体装置10へと流れる交流信号がきわめて少なくなる結果、デバイスの発振現象が起きることを抑えることができる。

#### く実施例>

本発明実施例を、以下、図面に基づいて説明する。

第1図は本発明実施例の構成を示す平面図、第 2図はその側面図であって、本発明をHEMTデバイスの直流特性の測定に適用した例を示す。

基板1の中央部は開口されており、この開口部1 a 周縁に沿ってプローブ針3, 4 および5 が配設されている。これらのプローブ針3, 4, 5 の先端の位置は、ウェハWのHEMTデバイス10のドレイン電極13, ソース電極14, ゲート電極15の配設位置にそれぞれ対応しており、ウェ

ることを防止でき、HEMTデバイス10の発振 現象を抑えることができる。これにより、常に正 確な測定値を得ることが可能となる。

ここで、本発明実施例を用いてHEMTデバイ ス10の直流特性をオンウェハの状態で測定した ところ、第3図に示すような1-V特性を得た。 ただし、ソース電極用プロープ針4は接地電位と して、ドレイン電極用プローブ針3に正のバイア ス電圧、ソース・ドレインパイアスVpsを印加し つつ同時に、ゲート電極用プローブ針5に負のバ -イアス電圧、ゲートバイアスV。を印加し、この ときドレイン電極用プロープ針3に流れる電流を ドレイン電流」。とした。一方、第4図に示した プローブカードを用いて、同じデバイスを上記と 同様にして測定したところ、第5図に示すような I-V特性を得た。この第5図および先の第3図 から明らかなように、従来のプローブカードを用 いた場合には、発振現象によって、I-Vカーブ が、特に電流の飽和領域で乱れているのに対し、 本発明実施例を用いた場合にはI-Vカープの乱

れは見られず、直流特性を正確に測定できることが判明した。

また、本発明実施例を用いてオートプローバによって、ウェハ上の全てのHEMTデバイスの測定を行い、テスト基準内のデバイスをチップ化実装した状態で直流特性の測定を行ったところ、この実装後のテスト基準外の不良デバイスは、数パーセント以下であった。

以上は、本発明をHEMTデバイスに適用した 例について説明したが、他のFETデバイスの直 流測定にも適用できることは勿論である。

### <発明の効果>

以上説明したように、本発明によれば、例えば HEMTデバイス等の直流特性を測定するにあた り、従来問題とされていた発振現象を抑えること ができ、常に正確な測定を行うことができる。こ れにより、オートプローバによる自動測定が可能 となって、測定の高速化、ひいては半導体装置製 造工程におけるスループットの向上をはかること ができる。さらに、オンウェハの状態でデバス の直流特性を正確に測定できることから、チップ 化実装後における直流特性テストをパスする製品 の歩留りの向上をはかることができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の構成を示す平面図で、 第2図はその側面図である。

第3図は、本発明実施例を用いてHEMTデバイスを測定した際のI-V特性の例を示すグラフである。

第4図は従来のプローブカードの構成例を示す 平面図である。

第5図は、第4図のプローブカードを用いてH EMTデバイスを測定した際のI-V特性の例を 示すグラフである。

1・・・基板

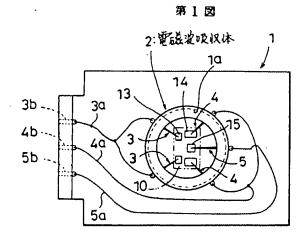
2・・・フェライト製リング

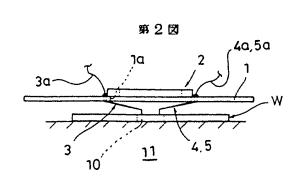
3, 4, 5・・・プロープ針

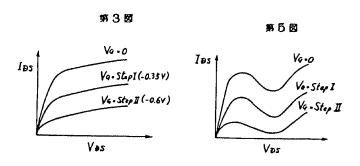
3 a. 4 a, 5 a···配線

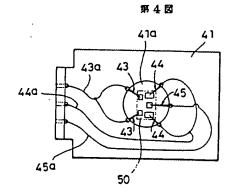
10···HEMTデバイス

W・・・ウェハ









BEST AVAILABLE COP'